

Reglement NVOI Stipendium

Algemeen

De Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI) beheert het Stipendiumfonds van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) waaruit een NVOI Stipendium wordt verstrekt voor onderzoek op het gebied van de orale implantologie.

In dit Reglement worden de uitgangspunten van het NVOI Stipendium beschreven alsook de criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor toekenning van een stipendium.

Dit Reglement geldt vanaf 11 december 2012 en blijft geldig tot het bestuur van de NVOI een nieuw Reglement bekend maakt.

NVOI Stipendium

1. *Doel:* het NVOI Stipendium is een geldelijke bijdrage die ter beschikking wordt gesteld ter stimulering/bekostiging van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orale implantologie binnen het kader van de doelstellingen van de NVOI, alles in de ruimste zin des woords.
2. *Vermogen:* het vermogen in het Stipendiumfonds wordt gevormd door:
 - a. een door de NVOI daarvoor ter beschikking gesteld bedrag van € 10.000,--.
 - b. een door de NSOI daarvoor ter beschikking gesteld bedrag van € 15.000,--.
 - c. een jaarlijks door de NSOI nader vast te stellen bijdrage.
 - d. subsidies en donaties.
 - e. alle andere verkrijgingen en baten.
3. *Toekenning:*
 - a. Het NVOI Stipendium wordt 1 x per jaar toegekend.
 - b. Toekenning vindt plaats tijdens het Najaarscongres van de NVOI.
 - c. Het NVOI Stipendium kan worden toegekend aan een persoon/personen of aan een instelling/instituut en bedraagt maximaal € 15.000,-- per jaar.
 - d. Aanvragen voor het NVOI Stipendium worden beoordeeld door het bestuur van de NVOI, zo gewenst aangevuld met daarvoor door het bestuur aangewezen leden van de NVOI. Besluitvorming over toekenning geschiedt in een bestuursvergadering.
4. *Criteria:* aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
 - a. Relatie met het vakgebied van de orale implantologie.
 - b. Relevantie van de vraagstelling voor wetenschap, kliniek en/of maatschappij.
 - c. Duidelijkheid van de vraagstelling/nulhypothese en onderzoeksmethode.
 - d. Originaliteit.
 - e. Uitvoerbaarheid van het onderzoek in de gestelde tijd en met de beschikbare middelen.
 - f. Intentie om de resultaten van het onderzoek te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de orale implantologie.

- g. Looptijd van het onderzoek tot concrete (eerste) resultaten (maximaal 4 jaar).
- h. Begroting van het onderzoeksproject:
totale kosten van het project en de verdeling van de kosten over de verschillende posten.
 - Posten die tot reguliere uitrusting of werkprogramma van de beoogde uitvoerder of het betreffende instituut kunnen worden gerekend, komen niet in aanmerking.
 - Aan kosten voor eigen salaris of voor congresbezoek wordt geen bijdrage verleend.
- i. Aanvragen voor onderzoeksprojecten met terugwerkende kracht worden niet in behandeling genomen.

Procedure

- Een aanvraag moet worden ingediend vóór 1 juli van het betreffende jaar en worden geadresseerd aan het bestuur van de NVOI, p/a secretariaat NVOI.
- De aanvragen worden door het bestuur blind (d.w.z. zonder naam /afkomst) beoordeeld.
- Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het digitaal verkrijgbare Aanvraagformulier NVOI Stipendium. Dit aanvraagformulier is te downloaden van de website van de NVOI (zoekwoord Stipendium).
- Wanneer voor het betreffende onderzoek goedkeuring van een METC vereist is, dan kan een aanvraag voor een NVOI Stipendium pas worden ingediend wanneer ook een kopie van de METC aanvraag is bijgevoegd.
- Aanvragers ontvangen uiterlijk 1 oktober schriftelijk bericht over toekenning of afwijzing.
- De ontvanger van het NVOI Stipendium zal middels een korte presentatie de leden van de NVOI tijdens het Najaarscongres informeren over het bekroonde project.
- Het NVOI Stipendium dient in de in de aanvraag aangegeven periode te worden besteed.
- Een kort inhoudelijk verslag inclusief een financiële afrekening van het onderzoek dient binnen zes maanden na afloop van het onderzoeksproject door het bestuur van de NVOI te zijn ontvangen.